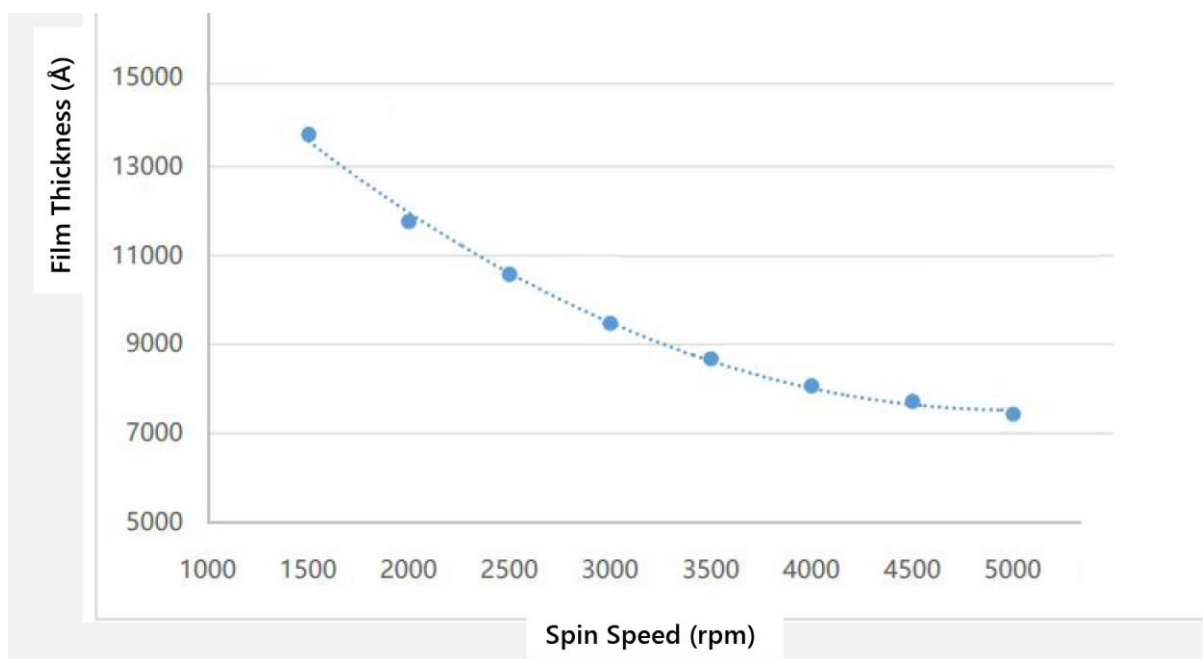


НЕГАТИВНЫЙ ФОТОРЕЗИСТ AR-211NL

AR-211NL представляет собой негативный фоторезист из диазидоциклизированного каучука, хорошо подходящий для производства полупроводниковых дискретных устройств и интегральных схем.

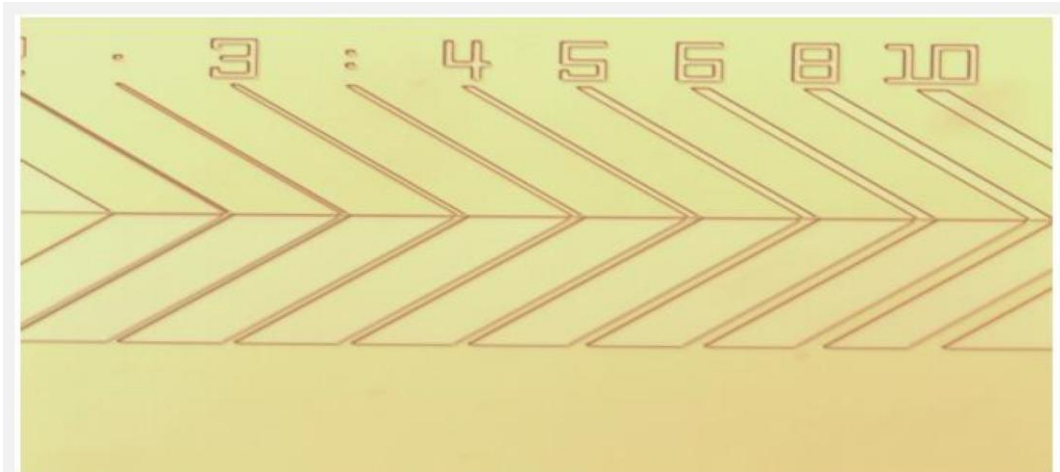
Фоторезист обладает:

- высоким термическим сопротивлением
- высокой химической стабильностью и очень хорошей адгезией
- высоким разрешением до 2 мкм.
- диапазон толщины плёнки от 0,75 до 1,4 мкм



| |
|---|
| Вязкость при температуре 25°C - 30 ± 5 сСт |
| Мягкая сушка - 100°C, 30 мин (печь) и 90°C, 90 сек. (плита) |
| Жёсткая сушка - 140°C, 30 мин. (печь) и 150°C, 3 мин. (плита) |
| Экспонирование – 30 - 40 мДж/см ² |

Толщина: 1 мкм, Экспонирование: 36 мДж/см²



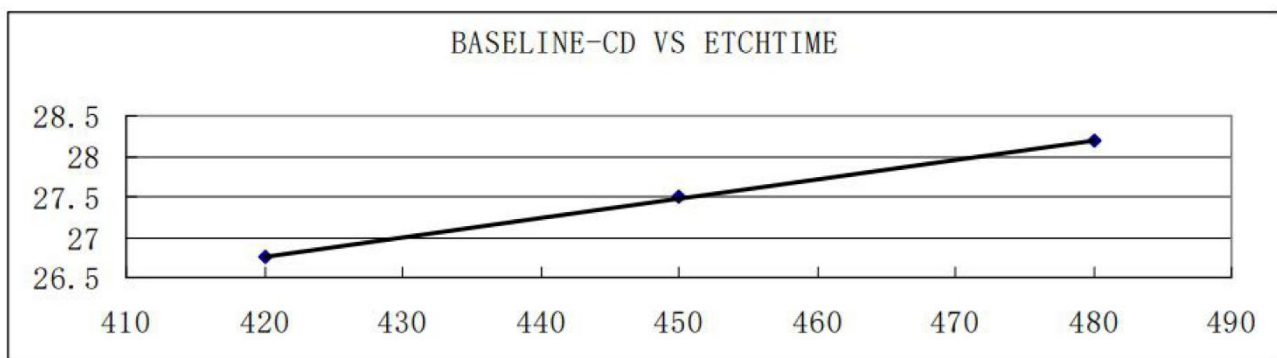
Жёсткая сушка - 140°C, 30 мин. (печь)

Буферизованное оксидное травление при 35°C (фторид аммония NH₄F и 49% плавиковая кислота HF)

| ETCHTIME=420sec | up | mid | down | left | right | average |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| CD | 26.82 | 26.64 | 26.82 | 26.64 | 26.82 | 26.748 |

| ETCHTIME=450sec | up | mid | down | left | right | average |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| CD | 27.72 | 27.36 | 27.54 | 27.54 | 27.36 | 27.504 |

| ETCHTIME=480sec | up | mid | down | left | right | average |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| CD | 28.44 | 28.26 | 28.08 | 28.26 | 27.9 | 28.188 |



Условия хранения и применения:

Хранить в закрытом оригинальном контейнере.

Защищайте от солнечного света.

Хранить в прохладном и сухом помещении.

Рекомендуется постоянная температура от 0 до 25 °C.

Применение при желтом освещении.

Срок годности при соблюдении условий хранения 12 месяцев от даты производства.